

2013年8月1日 星期四

一周工作安排
领导日程安排

用户名

密码

- 学术期刊
- 核技术
 - Nucl. Sci. Tech.
 - 辐射研究与辐射工艺学报

- 所内链接
- 上海光源
 - TMSR内网
 - 上海市核学会
 - ARP系统
 - SINAP电子邮件
 - SSRF电子邮件
 - 所级公共技术服务中心

- 友情链接
- 中国科学院
 - 中国科技网
 - 中国科学院上海分院
 - 中科院重大科学装置
 - 国家基金委
 - 上海分院科技合作网
 - 大型仪器区域中心

导师简介



方国平，1964年12月出生，大学本科学历，理学学士，研究员，硕士生导师。现任上海光源副总工艺师、公用设施技术部主任。

电话：021-39194990、33933177

电子邮箱：fangguoping@sinap.ac.cn

主要研究方向

上海光源工艺冷却水优化设计、工艺冷却水系统构成与原理设计、工艺冷却水系统构成与温度控制精度的研究、工艺冷却水在保证水温精度下的节能研究，温度调节手段研究。

个人主要经历

一、学习经历

开始日期	结束日期	学校	专业	学位
1982年09月	1986年06月	山东大学		理学学士学位

二、科研工作经历

主要从事加速器用的工艺冷却水、电、气的设计工作。
现主持上海光源公用设施分总体的设计与建设工作。

个人主要学术成就

工艺冷却水温度精度的控制手段和方法研究近几年来国外光源装置给予了很大的重视，由于其温度变化对束流稳定性的影响，国外光源装置对水的温度精度提出了很高的要求。基于上海光源装置工艺冷却水温度精度的要求，我们对工艺冷却水温度 $45 \pm 0.1^\circ\text{C}$ 、 $35 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 、 $30 \pm 0.2^\circ\text{C}$ 等不同等级的基准温度和精度进行了研究，并在小流量的冷却水系统中取得了比较好的结果。

主要包括工艺冷却水系统的设计、工艺冷却水温度精度的控制手段和方法、工艺冷却水温度变化对束流稳定性的影响。

代表性工作：100MeV电子直线加速器工艺冷却水水温控制；

在国内外学术刊物上已发表学术论文若干篇。

李文静、吴立、金惠明、袁平均、方国平，上海光源工程(SSRF)工艺冷却水系统设计，暖通空调，2008-6：71-75；

李立、方国平等，模糊PID控制在冷却水温控制系统中的应用，控制工程，2008-05：122-125

